

中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

2018 年度自行监测公开方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发【2013】81号）要求，中芯国际集成电路制造（北京）有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

一、企业基本情况

1. 企业基础信息

中芯国际集成电路制造(北京)有限公司，所属行业为集成电路制造，行业代码3963，目前约有2500 名员工。本企业位于北京经济技术开发区文昌大道18号。厂区东临文昌大道，北临地盛中街，西临绿地空地及地盛北街、地盛西街和地盛南街，南临西环中路。本企业是从事半导体生产的高新技术企业。2002年开始建设中芯国际（北京）一期项目，2004年投产，生产产品为12英寸芯片，生产规模2万片/月。2005开始建设中芯国际（北京）一期增资扩产项目，扩产后，批复产能规模为4.3万片/月。于2017年6月取得一期第二次增资扩产环境影响报告表批复，本次扩产0.7万片/月。目前批复产能规模达到5万片/月。芯片生产产生的污染物主要有生产废水（含氟、含氨、酸碱）、工艺废气（酸、碱、有机）、生活污水、辅助动力设备噪声以及固体废物和废液。详见表1。

表 1 企业基础信息

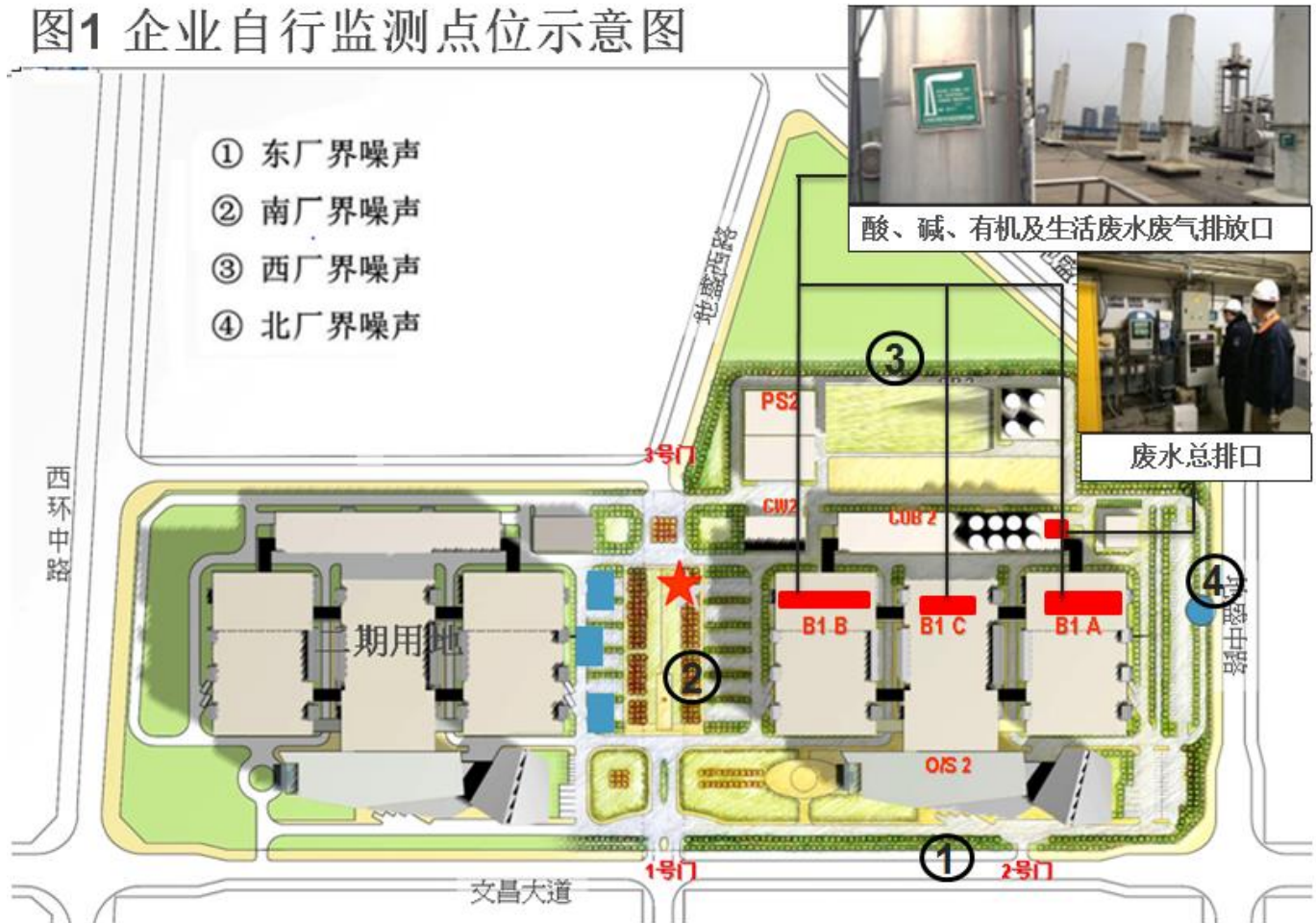
企业名称	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司		
污染源类型	<input type="checkbox"/> 废气企业 <input checked="" type="checkbox"/> 废水企业 <input type="checkbox"/> 污水处理厂		
地址	北京经济技术开发区文昌大道 18 号		
所在地经度	116°30'	纬度	39°46'
法人代表	赵海军	法人代码	74040172-3
联系人	田静	联系方式	18911229283
所属行业	集成电路制造	投运时间	2004 年 9 月
自行监测方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自动检测与手工检测相结合 <input type="checkbox"/> 仅自动检测 <input type="checkbox"/> 仅手工检测		
自动监测运维方式	企业自运维	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	委托第三方运营机构名称	沃德精准（北京）科贸有限公司	
手工监测方式	自承担	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	委托检测机构名称	谱尼测试集团股份有限公司和北京华测北方检测技术有限公司	
排放污染物名称	生产废水，生活废水，酸性废气，碱性废气，有机废气，生活废水排气，厂界噪声		
主要产品	12 英寸芯片		

生产周期	24 小时连续生产
主要生产工艺	清洗、热氧化、扩散、化学气相沉积、物理气相沉积、光刻、离子注入、蚀刻
治理设施	中央废气处理设施（碱液喷淋吸收塔，酸性喷淋吸收塔，沸石浓缩转轮燃烧系统），工业废水处理站（含氟废水处理、含氨废水处理、中和废水处理等系统），生活污水处理（化粪池、隔油池、生化处理池）

2. 监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图 1

图1 企业自行监测点位示意图



废水排放点位为废水总排放口，对应的排放口编号为 WS-001。生活废水经过化粪池/隔油池后进入 A/O 生化处理系统处理后排入工业废水处理系统。工业废水排放口位于厂区北侧，工业废水分为含氟废水、含铜废水、研磨废水、含氨废水和酸碱废水，含氟废水含铜废水、研磨废水的处理工艺为絮凝沉淀，含氨废水的处理工艺为吹脱法，上述四种废水经过各自的处理系统后进入中和池和酸碱废水混合调节酸碱后排入金源经开污水处理厂。

工业废气分为酸性废气、碱性废气和有机废气，还有生活废水处理系统废气排放口。工业废气排放口和生活废水处理系统废气排放口位于厂房的顶层。酸性废气主要污染物来源于生产过程中的蚀刻（酸）、化学气相沉积、扩散等工艺，酸性废气处理设施为碱液喷淋洗涤塔；碱性废气主要污染物来源于生产过程中的刻蚀（碱）、化学气相沉积、金属化等工艺，碱性废气处理设施为酸液喷淋洗涤塔；有机废气主要污染物来源于生产过程的均胶、光刻等工艺，有机废气处理设施为沸石浓缩转轮燃烧设备。生活废水处理系统排气主要是生活废水生化处理过程产生的臭气，通过酸碱洗涤塔处理。废气经过各自的处理系统之后通过排气筒排入大气。

噪音监测点分布在厂区东南西北四周外1米。

排污点位具体信息见表2

表2 排污点位信息






序号	编号	编码	污染物名称	污染来源	治理设施	位置	经度（东经）	纬度（北纬）	排放口照片	排放方式	排放去向
1	WS-001	WS-0001	pH值，化学需氧量（CODcr），氨氮，悬浮物(SS)，五日生化需氧量（BOD5），氟化物，总铜，总磷，石油类，总有机碳，总氮，动植物油，阴离子表面活性剂，	生产过程产生废水，及纯水制备过程废水等及经过处理的生活废水（洗手池，卫生间废水，餐厅废水）	含氟废水处理系统、研磨废水处理系统、含氨废水处理系统、含铜废水处理系统、中和废水处理系统、生化处理池	CUB 1F	116° 30' 38.6454"	39° 47' 29.0178"		有组织	排入污水处理厂
2	WS-003	WS-0003	总砷	碱液喷淋洗涤塔、工艺流程指中含氟废水	NA	CUB 2F	116°30'21"	39°46'59"		有组织	进入中和池后排入污水处理厂
3	FQ-001	FQ-0001	硫酸雾，氟化物，氯化氢，氯气，氮氧化物，二氧化硫，烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.5036"	39° 47' 27.0414"		有组织	排入大气

4	FQ-002	FQ-0002	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.3812"	39° 47' 27.096"		有组织	排入大气
5	FQ-003	FQ-0003	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.6188"	39° 47' 27.1098"		有组织	排入大气
6	FQ-004	FQ-0004	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.8738"	39° 47' 27.672"		有组织	排入大气
7	FQ-005	FQ-0005	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.7592"	39° 47' 27.3624"		有组织	排入大气
8	FQ-006	FQ-0006	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.153"	39° 47' 23.6508"		有组织	排入大气
9	FQ-007	FQ-0007	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.1032"	39° 47' 23.5242"		有组织	排入大气

10	FQ-008	FQ-0008	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 38.844"	39° 47' 23.463"		有组织	排入 大气
11	FQ-036	FQ-0036	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 39.7434"	39° 47' 27.8586"		有组织	排入 大气
12	FQ-037	FQ-0037	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 39.7434"	39° 47' 27.8586"		有组织	排入 大气
13	FQ-040	FQ-0040	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.0664"	39° 47' 20.7882"		有组织	排入 大气
14	FQ-041	FQ-0041	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.214"	39° 47' 20.6046"		有组织	排入 大气
15	FQ-042	FQ-0042	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.232"	39° 47' 20.6916"		有组织	排入 大气
16	FQ-058	FQ-0058	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.4438"	39° 47' 21.372"		有组织	排入 大气

17	FQ-059	FQ-0059	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 37.7244"	39° 47' 21.051"		有组织	排入大气
18	FQ-009	FQ-0009	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.7016"	39° 47' 26.6604"		有组织	排入大气
19	FQ-010	FQ-0010	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1A 厂房屋顶	116° 30' 40.4568"	39° 47' 26.7396"		有组织	排入大气
20	FQ-011	FQ-0011	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.333"	39° 47' 23.7258"		有组织	排入大气
21	FQ-012	FQ-0012	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.297"	39° 47' 24.3774"		有组织	排入大气
22	FQ-043	FQ-0043	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.4438"	39° 47' 21.4512"		有组织	排入大气
23	FQ-044	FQ-0044	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.3364"	39° 47' 21.2454"		有组织	排入大气

24	FQ-013	FQ-0013	非甲烷总烃 氮氧化物 二氧化硫 烟尘	各工序使用有机溶剂清洗过程	沸石浓缩转轮 燃烧系统	B1A 厂房屋顶	116° 30' 39.4554"	39° 47' 25.728"		有组织	排入 大气
25	FQ-014	FQ-0014	非甲烷总烃 氮氧化物 二氧化硫 烟尘	各工序使用有机溶剂清洗过程	沸石浓缩转轮 燃烧系统	B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.87"	39° 47' 23.607"		有组织	排入 大气
26	FQ-060	FQ-0060	非甲烷总烃 氮氧化物 二氧化硫 烟尘	各工序使用有机溶剂清洗过程	沸石浓缩转轮 燃烧系统	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.4156"	39° 47' 20.9652"		有组织	排入 大气
27	FQ-064	FQ-0064	硫化氢 氨气	生活废水处理过程产生的废气	酸碱洗涤塔	B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.7828"	39° 47' 19.7304"		有组织	排入 大气
28	FQ-066	FQ-0066	硫酸雾,氟化物,氯化氢,氯气,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	来源于工艺流程中对芯片的腐蚀、清洗过程	碱液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.009"	39° 47' 23.5854"		有组织	排入 大气
29	FQ-067	FQ-0067				B1C 厂房屋顶	116° 30' 39.1494"	39° 47' 24.4644"		有组织	排入 大气
30	FQ-068	FQ-0068				B1B 厂房屋顶	116° 30' 38.0766"	39° 47' 24.414"		有组织	排入 大气

31	FQ-069	FQ-0069	氨气	来源于蚀刻工序和工艺过程中使用氨水和氨气等过程	酸液喷淋吸收塔	B1C 厂房屋顶	116° 30' 38.9448"	39° 47' 24.4746"		有组织	排入大气
32	FQ-070	FQ-0070	非甲烷总烃,氮氧化物,二氧化硫,烟尘	各工序使用有机溶剂清洗过程	沸石浓缩转轮燃烧系统	B1C 厂房屋顶	116° 30' 40.1328"	39° 47' 24.1506"		有组织	排入大气
33	WZ-065	WZ-0065	臭气	生活废水处理过程产生的废气	-	1号 门附近	-	-	-	无组织	排入大气
34	FQ-071	FQ-0071	砷及其化合物	离子注入工序	二级吸附	B1A 厂房 4F	116° 29' 54.873"	39° 46' 59.9082"		有组织	排入大气
35	FQ-072	FQ-0072	砷及其化合物	离子注入工序	二级吸附	B1C 厂房 4F	116° 29' 54.0018"	39° 46' 56.9598"		有组织	排入大气
36	FQ-073	FQ-0073	砷及其化合物	离子注入工序	二级吸附	B1B 厂房 4F	116° 29' 53.592"	39° 46' 53.2518"		有组织	排入大气

备注:

1. FQ-066、067、068、069 为二期第二次增资扩产项目新增废气排放口，目前未投入使用，开始排污时即对这四个排口按照要求进行监测和数据公开
2. FQ-070 为有机废气处理备用系统，正在准备验收
3. FQ-003、014、068 已经安装废气在线监测，监测项目为氮氧化物，二氧化硫和颗粒物。目前在线设备已经安装完毕，正在调试中。待调试完成将申请验收，验收通过后将采用在线数据公开

二、监测内容及公开时限

1. 废气监测

本企业排气管路为圆形，采样位置位于垂直管路，且已避开弯头，无急剧变化断面；按要求设置采样平台；属于圆形烟道，在互相垂直的直径线上设立采样孔。

废气监测内容见表 3

表 3 废气监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	检测承担方	监测频次	公开时限
废气	手工监测	酸性废气排口，共 18 个(包含 50K 新建 3 个)。 FQ001~008, FQ036、037, FQ040~042, FQ058、059 FQ066、067、068	硫酸雾 氟化物 氯化氢 氯气 氮氧化物 二氧化硫 烟尘	委托社会化 监测机构	每季度监测 1 次，其中氮氧化物、二氧化硫和烟尘每月监测 1 次	完成监测后次日公布
		碱性废气排口，共 7 个(包含 50K 新建 1 个)。 FQ009~012 FQ043、044 FQ069	氨气			
		有机废气排口，共 4 个(包含 1 个备机)。 FQ013、014、060 FQ070	非甲烷总烃 氮氧化物 二氧化硫 烟尘			
		砷车间排放口，共 3 个，FQ071、072、073	砷及其化合物			
生活废水周围 废气	手工监测	生活废水站附近 WZ-065	臭气；	委托社会化 监测机构	每季度监测 1 次	完成监测后次日公布
		FQ064	H ₂ S;氨气			
<p>备注: 1. FQ-066、067、068、069 为一期第二次增资扩产项目新增废气排放口,目前未投入使用,开始排污时即对这四个排口按照要求进行监测和数据公开</p> <p>2. FQ-070 为有机废气处理备用系统,正在准备验收</p> <p>3. FQ-003、014、068 已经安装废气在线监测,监测项目为氮氧化物, 二氧化硫和颗粒物。目前在线设备已经安装完毕, 正在调试中。待调试完成将申请验收, 验收通过后将采用在线数据公开</p>						

2. 废水监测

废水部分由自动监测和手工监测,手工采样样品的保存满足水质采样样品的保存和管理技术规范 HJ 493-2009

废水监测内容见表 4。

表 4 废水监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频率	公开时限
废水	自动监测	工业废水排口	pH 值, 化学需氧量 (CODcr), 氨氮	第三方运维	每 2 小时监测 1 次	实时公开
废水	手工监测	废水总排口	悬浮物(SS), 五日生化需氧量 (BOD5), 氟化物, 总铜, 总磷, 石油类, 总有机碳, 总氮, 动植物油, 阴离子表面活性剂	委托社会化监测机构	每月监测 1 次	完成监测后次日公布
	手工监测	车间排口	总砷	委托社会化监测机构	每月监测 1 次	完成监测后次日公布

3. 噪声监测

噪声监测内容见表 5。

表 5 噪声监测情况一览表

类别	监测方式	检测点位	监测项目	检测承担方	监测频率	公开时限
厂界噪音	手工监测	厂东, 南, 西, 北	连续等效 A 声级	委托社会化监测机构	每季度监测 1 次	完成监测后次日公布

三、监测评价标准

根据环境保护部《关于中芯国际集成电路制造(北京)有限公司一期增资扩产项目环境影响报告书审查意见的复函》及《关于中芯国际集成电路制造(北京)有限公司一期增资扩产项目竣工环境保护验收意见的函》及《关于中芯国际集成电路制造(北京)有限公司一期第二次增资扩产环境影响报告表的批复》，本企业执行标准如下：

1. 废气评价标准

废气排放执行北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值 表 3 中 II 时段的规定。

表 6 废气评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限制	评价标准
废气	酸性废气排口, 共 18 个(包含 50K 新建 3 个)。	硫酸雾	5.0mg/m ³	
		氟化物	3.0mg/m ³	

	FQ001~008, FQ036、037, FQ040~042, FQ058、059 FQ066、067、068	氯化氢	10mg/m ³	北京市《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017) 生产工艺废气及其他 废气大气污染物排放 限值表3中II时段的规定
		氯气	3.0mg/m ³	
		氮氧化物	100mg/m ³	
		二氧化硫	100mg/m ³	
		烟尘	10mg/m ³	
	碱性废气排口,共7 个(包含50K新建1 个)FQ009~012、 FQ043、044、 FQ069	氨气	10mg/m ³	
		有机废气排口,共4 个(包含1个备机)。 FQ013、014、060 FQ070	非甲烷总烃	
	氮氧化物		100mg/m ³	
	二氧化硫		100mg/m ³	
	烟尘		10mg/m ³	
砷车间排放口,共3 个,FQ071、072、 073	砷及其化合物	0.5 mg/m ³		
废气	生活废水站附近 WZ-065	臭气	20	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)
	FQ-064	H ₂ S	3	北京市《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017) 生产工艺废气及其他 废气大气污染物排放 限值表3中II时段的规定
		氨气	10	
备注: 1. FQ-066、067、068、069 为一期第二次增资扩产项目新增废气排放口,目前未投入使用,开始排污时即对这四个排口按照要求进行监测和数据公开 2. FQ-070为有机废气处理备用系统,正在准备验收 3. FQ-003、014、068已经安装废气在线监测,监测项目为氮氧化物,二氧化硫和颗粒物。目前在线设备已经安装完毕,正在调试中。待调试完成将申请验收,验收通过后将采用在线数据公开				

2. 废水评价标准

废水执行北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)标准,详见表7

表7 废水评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
		pH值(无量纲)	6.5~9(无量纲)	北京市《水污染物综

废水	废水总排口	化学需氧量 CODcr	500 mg/L	合排放标准》 (DB11/307-2013) 表3 排污公共污水处理系统
		氨氮	45 mg/L	
		生化需氧量 BOD5	300 mg/L	
		氟化物	10 mg/L	
		悬浮物 (SS)	400 mg/L	
		总铜	1 mg/L	
		总磷	8 mg/L	
		石油类	10 mg/L	
		总有机碳 TOC	150 mg/L	
		总氮	70 mg/L	
		动植物油	50 mg/L	
		阴离子表面活性剂 LAS	15 mg/L	
	车间排口	总砷	0.1 mg/L	

3. 噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348~2008) 3类区域标准, 详见表8。

表8 噪声评价标准一览表

类别	监测项目	标准值 dB (A)		评价标准
		昼间	夜间	
厂界噪声	连续等效 A 声级	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348~2008) 3类区域标准

四、监测方法及监测质量控制

1. 自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。自动监测方法及仪器设备详见表9。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

表9 污染物自动监测方法及依据一览表

污染源类别	排放口编号	污染物名称	自动监测采样方法及依据		自动测定方法		检出限	仪器设备名称和型号
废水	WS-001	pH	自动采样器	HJ/T 96-2003 pH 水质自动分析仪技术要求	玻璃电极法	水污染源在线监测系统安装技术规范 HJ/T 353—2007	0.1pH	HB-121DA
		化学需氧量	自动采样器	HJ/T377-2007《化学需氧量（COD _{Cr} ）水质自动在线监测仪技术要求	重铬酸钾法		1mg/L	HACH COD max 化学需氧量在线分析仪
		氨氮	自动采样器	HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求	钠试剂比色		0.2mg/L	HACH Amtax Compact 氨氮在线分析仪
废气	FQ-003 FQ-014 FQ-068	氮氧化物	抽取直测试法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	非分散红外法	HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定非分散红外吸收法	3mg/L	雪迪龙 SCS-900
		二氧化硫	抽取直测试法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	非分散红外法	HJ629-2011 固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法	3mg/L	雪迪龙 SCS-900
		烟尘	激光后散射法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	激光后散射法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	0.1mg/L	安荣信 LSS2014

2. 手工监测

各类污染物采用国家和北京市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方案标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表10。

本企业委托有资质的社会化检测机构开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。2017年我单位委托谱尼测试集团股份有限公司和北京华测北方检测技术有限公司进行手工监测。

表 10 污染物手工监测方法及依据一览表

污染源类别	排放口编号	污染物名称	手工监测采样方法及依据		样品保存	手工测定方法		检出限	仪器设备名称和型号
废气	FQ-001 FQ-002 FQ-003 FQ-004 FQ-005 FQ-006	氯气	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品可用多孔波板吸收瓶避光保存	甲基橙粉光光度法	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙粉光光度法 HJ/T30-1999	0.2mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800 紫外可见分光光度计 TU-1901
	FQ-007 FQ-008 FQ-036 FQ-037 FQ-040 FQ-041 FQ-042 FQ-058 FQ-059	氯化氢	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品至于 3-5℃保存	离子色谱法	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549 -2016	0.2mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 离子色谱仪 ICS-1000 离子色谱仪 QIONEX-AQUION
	FQ-066 FQ-067 FQ-068	氟化物	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品可用多孔波板吸收瓶避光保存	离子选择电极法 硫氢酸汞分光光度法	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T67-2001 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氢酸汞分光光度法 HJ/T27-1999	0.06mg/m ³ 0.9mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 酸度计 PhS-3C

	硫酸雾	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品避光保存, 要尽快分析	离子色谱法	固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ544-2016	0.2mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 离子色谱仪 ICS-1000 离子色谱仪 QIONEX-AQUION
	氮氧化物	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品至于 3-5℃ 保存	定电位电解法 盐酸萘乙二胺分光光度法	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T43-1999	3mg/m ³ 0.7mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800
	二氧化硫	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品可用多孔波板吸收瓶避光保存	分光光度法 定电位电解法	<空气和废气监测分析方法>(第四版增补版)5.4.1 二氧化硫的测定 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	0.3mg/m ³ 3mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 紫外可见分光光度计 UV-1800
	烟尘	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品采用专用滤筒盒保存	重量法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 重量法	0.5mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 电子天平 ME204/02 电子天平 AL204
FQ-009 FQ-010 FQ-011 FQ-012 FQ-043 FQ-044 FQ-069	氨气	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品需要在 2-5℃ 低温保存	分光光度法	环境空气和废气 氨的测定 纳式试剂分光光度法 HJ533-2009	0.25mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800 紫外可见分光光度计 TU-1901

FQ-013 FQ-014 FQ-060 FQ-070	非甲烷总烃	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品避光保存	气相色谱法	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-1999	0.04mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 气相色谱仪 GC-2014
	氮氧化物	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品至于 3-5℃保存	定电位电解法 盐酸萘乙二胺分光光度法	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T43-1999	3mg/m ³ 0.7mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800
	二氧化硫	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品可用多孔波板吸收瓶避光保存	分光光度法 定电位电解法	<空气和废气监测分析方法>(第四版增补版)5.4.1 二氧化硫的测定 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法	0.3mg/m ³ 3mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800
	烟尘	连续采样	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	样品采用专用滤筒盒保存	重量法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	0.5mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 防爆个体采样器 EM-1500 电子天平 ME204/02 电子天平 AL204
FQ-071 FQ-072 FQ-073	砷及其化合物	连续采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/16157-1996	样品避光保存	电感耦合等离子体质谱法	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 HJ657-2013	0.0002 mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 电感耦合等离子体质谱仪 NexION350 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、TTE20131527

	FQ-064	硫化氢	连续采样	大气污染物地方排放标准 DB11/501-2017 恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993	样品避光保存	分光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 亚甲基蓝分光光度法 (B) 5.4.10.3	0.01mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800 紫外可见分光光度计 TU-1901
		氨气	连续采样		样品需要在 2-5℃低温保存	分光光度法	环境空气和废气 氨的测定纳式试剂分光光度法 HJ533-2009	0.25mg/m ³	自动烟尘(气)测试仪 3012H 智能双路烟气采样器 3072 便携式大气采样器 EM-1500 个体采样器 EM-1500 紫外可见分光光度计 UV-1800 紫外可见分光光度计 TU-1901
	WZ-065	臭气	瞬时采样		避光保存	三点比较式臭袋法	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	10	便携式大气采样器 EM-1500 个体采样器 EM-1500
废水总排口	WS-001	氟化物	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P, 1-5℃避光冷藏	离子色谱法 离子选择电极法	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987	0.006mg/L 0.05mg/L	离子色谱仪 ICS-1100 离子色谱仪(IC) ICS-1100 离子选择电极
		生化需氧量	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P,溶解氧瓶 1-5℃暗处冷藏	稀释与接种法	水质 五日生化需氧法的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	0.5mg/L	霉菌培养箱 MJ-250-I 生化培养箱 LRH-250 溶解氧测定仪 YSI5000 型
		悬浮物	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P 或 G,1-5℃暗处保存	重量法	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	5mg/L	电热鼓风干燥箱 101-2AB 分析天平 AB204-S 电子天平 AL-204

		总铜	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P, 1L 水样加入浓 HNO ₃ 10mL 酸化	电感耦合等离子体发射光谱法 电感耦合等离子体质谱法 萃取法	水质 32 种元素测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法萃取法 GB/T 7475-1987	0.04mg/L 0.08mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 725-ES 原子吸收分光光度计 (AAS) A3F-13
		总磷	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P 或 G, 硫酸酸化, HCl 酸化 pH≤2	钼酸铵分光光度法	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989	0.01mg/L	紫外分光光度计 UV-1800 紫外分光光度计 TU-1901
		石油类	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	溶剂洗 G, 用 HCl 酸化至 pH≤2	红外分光光度法	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012	0.04mg/L	红外分光测油仪 OIL480 红外分光测油仪 JDS-106U+
		总有机碳	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	G, 硫酸酸化 pH≤2, 1-5℃	燃烧氧化-非分散红外吸收法	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ501-2009	0.1mg/L	总有机碳分析仪 1030 总有机碳分析仪 2100
		总氮	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P 或 G, 硫酸酸化 pH1-2	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	0.05mg/L	紫外分光光度计 UV-1800 紫外可见分光光度计 (UV) lambda25
		阴离子表面活性剂	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	G 甲醇清洗, 1-5℃ 冷藏	亚甲蓝分光光度法	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987	0.05mg/L	紫外分光光度计 UV-1800 紫外分光光度计 TU-1901
		动植物油	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	溶剂洗 G, 用 HCl 酸化至 pH≤2	红外分光光度法	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012	0.04mg/L	红外分光测油仪 OIL480 红外分光测油仪 JDS-106U+
车间排口	WS-003	总砷	瞬时采样	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002	P 或 G, 1L 水样加入浓 HNO ₃ 10mL 酸化	原子荧光法	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光谱仪 AFS-930 原子荧光光度计 AFS-9700
噪声	厂界东、南、西、北外 1M	厂界噪声	瞬时采样	工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008	NA	NA	工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008	NA	噪声分析仪 声级计 AWA6228

备注: 1. FQ-066、067、068、069 为一期第二次增资扩产项目新增废气排放口,目前未投入使用,开始排污时即对这四个排口按照要求进行监测和数据公开
2. FQ-070 为有机废气处理备用系统,正在准备验收
3.P 为聚乙烯瓶,G 为硬质玻璃瓶
4. FQ-003、014、068 已经安装废气在线监测,监测项目为氮氧化物, 二氧化硫和颗粒物。目前在线设备已经安装完毕, 正在调试中。待调试完成将申请验收, 验收通过后将采用在线数据公开

3. 监测信息及保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告, 监测期间生产记录以及企业委托手工监测、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料(原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年, 其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年)。

本企业自行监测信息公开网址是: <http://www.smics.com/chn/about/esh.php>。该地址公开内容包括企业基础信息、自行监测方案、自行监测结果、污染源监测年度报告, 所有信息在网站保存一年。

中芯国际集成电路制造(北京)有限公司

2018年1月